ヘテロ積層したパイスタック分子の整流特性

 (東工大院・理¹,東工大・元素戦略センター²,東大院・工³)
○藤井 慎太郎¹,小本 祐貴¹,金 相殷¹,木口 学¹,多田 朋史², 大須賀 孝史³,村瀬 隆史³,藤田 誠³

Electrical rectification in hetero-stacked π -conjugated molecules

(Tokyo Tech.¹, Tokyo Tech., MCES², Tokyo Univ.³) OShintaro Fujii¹, Yuki Komoto ¹, Sougin Jin¹, Manabu Kiguchi¹, Tomofumi Tada ², Takafumi Osuga ³, Takashi Murase³, Makoto Fujita³

【序】 π 共役分子の集積体 (π スタック)を介した電荷輸送は、有機電子デバイスに おいて重要な役割を担っている。近年では、単一分子レベルでの π スタックを介した 伝導特性が報告され、その単分子エレクトロニクスへの応用が期待されている[1,2]。 本研究では、カゴ状錯体中に π 分子が積層して閉じ込められた π スタックについて、 その伝導特性の機能化に着目した。特に、ドナー π 分子とアクセプタ π 分子がヘテロ 積層した Aviram-Ratner 型の単一 π スタックに注目し、その分子ダイオード特性 [3,4]の計測を目指した。

【実験】マイカ上に金を真空蒸着し、約350℃で2時間アニーリングすることでAu (111) 基板を作製した。この基板上に、アクセプタ分子(ナフタレンジイミド、図 1a) とドナー分子(トリフェニレン、図1b)をヘテロ積層させたカゴ状錯体(図1 c) を分散させた。STM ブレイクジャンクション法に従い、大気中、金探針と金基板 間のポイントコンタクトを破断することで金ナノ電極を形成させ、そのナノ電極間に カゴ状錯体を捕捉することで分子接合を作製し、その電流-電圧特性の計測を行った。 整流特性の期待されるヘテロ積層πスタック(図1c)に加えて、対照実験としてホ モ積層πスタック(図1d)の電流-電圧特性の計測も併せて行った。電流-電圧特 性の計測は、バイアス電圧窓:±1V、掃引時間:~8 msの条件で行った。ヘテロ積 層およびホモ積層πスタックについて、それぞれ 500 個の分子接合の電流-電圧特性 を計測し、伝導度-電圧特性のヒストグラムを作成することで統計的な解析を行った。



【結果】図2ab にヘテロ積層およびホモ積層 π スタックの伝導度-電圧特性を示す ($G_0 = 2e^{2/h}$, e = 電気素量, h = プランク定数)。電圧±1.0 Vにおいて、ホモ積層 π スタックは 10⁻²~10⁻¹ G 領域に分布の狭い伝導度を示すのに対して、ヘテロ積層 π ス タックは 3×10⁻³~10⁻¹ G 領域に幅広な伝導度分布を示し、分子種に依存した伝導度-電圧特性を示す事が分かる。また、バイアス電圧 0.4~0.6 Vの領域の伝導度ヒスト グラムを解析すると (図 2c)、ホモ積層 π スタックは 5×10⁻² G んに単一の伝導度ピー ク構造を示すのに対し、ヘテロ積層 π スタックは 2×10⁻² G んと 3×10⁻³ G んに複数の伝導 度ピークを示す事が明らかとなった。この結果は、ヘテロ積層 π スタックに特徴的な、 アクセプタおよびドナー分子の積層順序に起因する整流特性を示している。個別の伝 導度-電圧特性を精査すると、ホモ積層 π スタックは対称な伝導度-電圧特性を示す のに対して、ヘテロ積層 π スタックは非対称な伝導度-電圧特性を示し、整流特性が 発現していることが確認された(図 2 ab、黒線)。ヘテロ積層 π スタックの整流性に ついて、500 個の分子接合の伝導度-電圧特性から統計的な解析を行った結果、バイ アス電圧±0.5 Vにおいて、2倍以上の整流比を示すことが分かった。また、第一原 理計算から、(ドナー) → (アクセプタ) 方向に電子が流れ易いことが確認された。

以上、π-π相互作用を制御したπスタックを作製し、その伝導度-電圧特性の統 計的な解析を行うことで、単一分子レベルのダイオード機能の確認に成功した。



図2 (a,b) 伝導度-電圧特性の二次元ヒストグラム (a) ヘテロスタック (b) ホモスタ ック分子、黒線は伝導度-電圧特性の一例 (c) バイアス電圧 0.4~0.6 Vでの伝導度ヒス トグラム、(a) (b) 中に、電圧範囲が白線で示されている。矢印 (*G*_{homo}, *G*_{hetero1}, *G*_{hetero2}) は伝導度ピークを示す。太線は隣接平均法によるスムージング結果。

【参考文献】

[1] Kiguchi, M., Takahashi, T., Takahashi, Y., Yamauchi, Y., Murase, T., Fujita, M., Tada, T. & Watanabe, S. *Angew. Chem. Int. Ed.* **50**, 5708–5711 (2011).

[2] Schneebeli, S. T., Kamenetska, M., Cheng, Z., Skouta, R., Friesner, R. A., Venkataraman, L. & Breslow R. J. Am. Chem. Soc. **133**, 2136–2139 (2011).

[3] Aviram, A. & Ratner, M. A. Chem. Phys. Lett. 29, 277–283 (1974).

[4] Tsuji, Y., Staykov, A. & K. Yoshizawa, J. Phys. Chem. C116, 2575-2580 (2012).